

广东众元半导体科技有限公司

分子束裂解炉

ZY-As-2000/5000/7000

砷 (As) 源炉产品



众元半导体
TrueOne® Semiconductor

<http://www.TrueOneTech.com>

分子束裂解阀炉 (ZY-As-2000/5000/7000)

用于超高真空 (UHV) 下蒸发砷 (As) 材料

工作温度: 350~750°C

适用于 VEECO 等市场上大部分的分子束外延 (MBE) 系统

该系列阀炉采用金属锥形阀门调节流量

阀门响应时间小于 3 秒 (全开到全关)

包含 2 个独立控制的加热区和 2 个高精度热电偶

顶端裂解区加热区的温度高于底部升华区加热区的温度

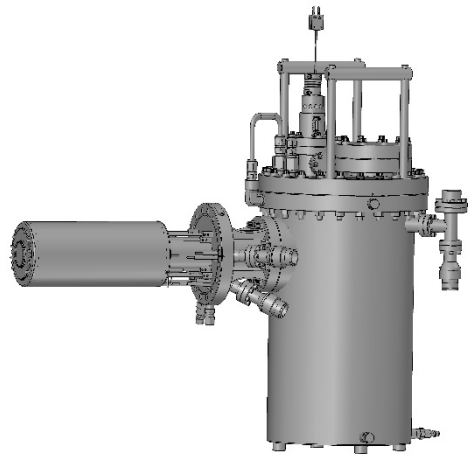
基于多物理场耦合的分子流仿真优化设计

热稳定性、温度精确控制以及操作控制等均达较高水平

满足精确控制外延层厚度、组分、掺杂和周期性等要求

性能与优点:

- ◆ 容量较大, 支持长时间工作;
- ◆ 源消耗较低;
- ◆ 更高效率 and 更彻底的除气;
- ◆ 更宽广的工作温度范围;
- ◆ 更精准的加热温度控制;
- ◆ 更大的源流量调控范围比;
- ◆ 更可靠的运行。



技术参数:

源型号	2000cc	5000cc	7000cc
最大填料重量	5.3Kg	13.25Kg	18.5Kg
坩埚直径	116mm	173mm	173mm
坩埚填料高度	181mm	214mm	300mm
真空内侧长度	284mm	290mm	290mm
真空内侧直径	63.8mm	76.6mm	76.6mm
填料口直径	116mm	38.1mm	38.1mm
上部除气温度	1400℃	1400℃	1400℃
上部使用温度	800~1150℃	800~1150℃	800~1150℃
下部除气温度	850℃	850℃	850℃
下部使用温度	350~750℃	350~750℃	350~750℃
温度稳定性	≤±0.1℃	≤±0.1℃	≤±0.1℃
阀门响应时间	小于 3 秒（全开到全关）		
最小安装法兰	法兰CF100, 可根据客户设备扩大		
开关比	≥1050		

详询: 广东众元半导体科技有限公司

地址: 广东佛山南海桂城街道平洲南港大街 5 号 1 楼

电话: 0757-81813939 传真: 0757-81813923

电邮: info@trueonetech.com